Crecimiento y caracterización de láminas delgadas con memoria de forma de alta temperatura Ni-Ti-Zr mediante sputtering.

Fernando Del Fedele

March 15, 2021



Contenido

- Introducción
 - Objetivo
 - Materiales con memoria de forma
 - Materiales con memoria de forma de alta temperatura
 - Transformación martensítica
- 2 Técnicas experimentales
 - Deposición por magnetrón sputtering
 - Microscopía electrónica de barrido
 - Difracción por rayos X
 - Microscopía electrónica de transmisión
 - Calorimetría diferencial de barrido
 - Resistividad por el método de cuatro puntas
- Resultados obtenidos



Materiales con memoria de forma

Las aleaciones con memoria de forma, de aquí en adelante nombradas como **SMA** (del inglés, **S**hape **M**emory **A**lloys) son aleaciones que pueden recuperar su forma original al ser calentadas luego de haber sufrido una deformación aparentemente plástica Entre sus propiedades, se encuentran:

- Superelasticidad
- Alta capacidad de amortiguamiento
- Alta relación entre la potencia entregada y su peso

Las aplicaciones actuales de los SMA están limitadas por debajo de los $100^{\circ}C$. Los materiales con memoria de forma de alta temperatura, abreviados como **HTSMA** (del inglés, **H**igh **T**emperature **S**hape **M**emory **A**lloys) son aquellos en los cuales la transformación martensítica sucede a $T>100^{\circ}C$. Lo más común a es a NiTi agregarle Pd o Pt en detrimento del Ti, pero recientemente se encontró que Hf o Zr tienen efectos aún mayores en la temperatura a menor costo relativo.

Transformación martensítica

La causa del efecto de memoria de forma es la transformación martensítica. Sus propiedades son

- Transformación de estado sólido
- Primer orden
- Sin difusión atómica
- Desplazamiento de los átomos del orden de 1 Å
- Los átomos mantienen relación con sus vecinos cercanos

La fase de menor temperatura, B19' pasa a la fase B2, que tiene mayor simetría al aumentar la temperatura. La fase recordada es aquella que está en la fase B2.



Figure: Fase B2.



Figure: Fase B19'.

Termodinámica de la transformación

Termo de la transformación

Deposición por magnetrón sputtering Microscopía electrónica de barrido Difracción por rayos X

alorimetría diferencial de barrido

Deposición por magnetrón sputtering



(a) Esquema magentrón.



(b) Magnetrones empleados durante las deposiciones.



Deposición por magnetrón sputtering Microscopía electrónica de barrido Difracción por rayos X Microscopía electrónica de transmisión Calorimetría diferencial de barrido Resistividad por el método de cuatro puntas

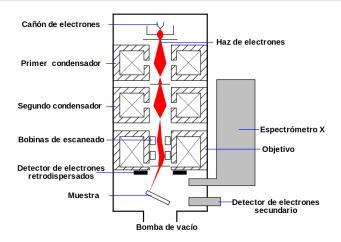


Figure: Esquema microscopio electrónico de barrido.

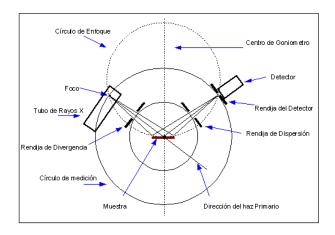


Figure: Esquema del dispositivo tipo Bragg-Brentano.

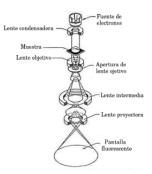


Figure: Esquema del tubo de un microscopio electrónico de transmisión

Introducción Técnicas experimentales Resultados obtenidos Deposición por magnetrón sputtering Microscopía electrónica de barrido Difracción por rayos X Microscopía electrónica de transmisión Calorimetría diferencial de barrido Resistividad por el método de cuatro puntas



Figure: Esquema del DSC empleado.

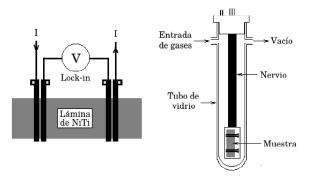


Figure: Esquema del sistema empleado para el método de resistividad por cuatro puntas.

Introducción Técnicas experimentales Resultados obtenidos

ACÁ PONER LAS DOS DEPS